【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成17年6月16日(2005.6.16)

【公開番号】特開2003-218096(P2003-218096A)
【公開日】平成15年7月31日(2003.7.31)
【出願番号】特願2002-18022(P2002-18022)
【国際特許分類第７版】
　ＨＯ１Ｌ　21/31
【ＦＩ】
　ＨＯ１Ｌ　21/31　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成16年9月17日(2004.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】符号の説明
【補正方法】変更
【補正の内容】
【符号の説明】
1　酸素イオン発生用真空処理装置
6　電気絶縁材、絶縁筒体
１２　引出電極用電源
１９　多孔導電板
２７　ランプ（加熱手段）
２８　反射板（加熱手段）
２９　多孔質セラミックス基板
３１　ガス導入パイプ